

Strukturelevantes Verhalten von Ni/P-Schichten in diversen Angriffsmedien



1 Einleitung Bekanntlich besitzen chemisch abgeschiedene Ni/P-Schichten mit geringem P-Gehalt in den üblichen Kurzzeit-Tests nach DIN 50021 SS, DIN 50021 ESS und DIN50018 0,2 bzw. 2,0 SO₂ geringere Korrosionsbeständigkeiten als solche mit hohem P-Gehalten. Gleichfalls ist bekannt, daß für hochkorrosionsbeständige Ni/P- Schichten mit Phosphorgehalten > 9 Gew% der Phosphor in röntgenamorpher Verteilung in der Schicht vorliegen muß („metallisches Glas“) und vor allem Schwefelverbindungen als Stabilisatoren nicht verwendet werden dürfen. Zur Herstellung von Ni/P-Schichten mit niedrigem oder hohem P-Gehalt mit den typischen Schichteigen.00t 0s0e0 11ee7 s Gspezillue